

京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 マスクレス リソグラフィー ～ 技術紹介と体験実習 ～

日時： 2024年 **11月15日** (金)

参加費無料

15:00～15:30 技術紹介

15:30～17:00 体験実習

場所： 京都大学 吉田キャンパス
ナノテクノロジーハブ拠点 クリーンルーム

<https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r-y>

(構内マップ57番 工学部物理系校舎327号室)

参加登録フォーム(先着順)：

<https://forms.gle/NgvXdY4riwfMVNtK7> **11/7(木)まで**

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点では、Heidelberg Instruments社製の2光子重合式3Dプリンター MPO 100 およびマスクレス露光装置 MLA 150の2台の共用を2024年4月から開始しています。

<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/news/2794/>

この度、京都府と(公財)京都産業21が主催する「京都半導体産業振興フォーラム」および応用物理学会が主催する第37回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議(MNC 2024)と連携し、当拠点のクリーンルームにて、MPO 100および MLA 150のマスクレス露光装置の紹介、およびMLA 150の体験実習を開催します。

マスクレス露光装置は、フォトマスク上のパターンをウエハーに転写する従来の露光装置とは原理が異なり、CADで作成したパターン情報を直接露光できるため、パターンを柔軟に変えられ、半導体の開発段階などで様々なアイデアをスピーディーに低コストで試すことができます。

なお、本実習は、観光庁 国際会議の開催効果拡大実証事業の支援を受け、MNC 2024 特別セミナー「京都府半導体産業振興・技術セミナー ～半導体事業への将来への取り組みと課題～」(<https://imnc.jp/2024/seminar-in-jp/>)と連携して無料で実施されます。



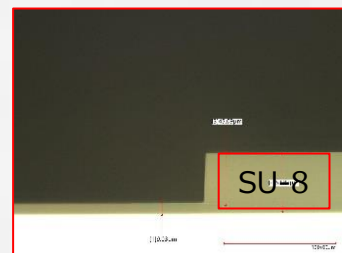
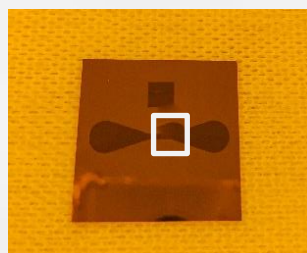
MPO 100



MLA 150



MLA150によるリソグラフィ結果
(京都大学時計台)
6インチウエハーに30分で描画



実習内容(予定) SU-8 2段露光

SU-8を1段目10 μ m、2段目50 μ mで露光し、高さが2段ある流路用モールドを作製する。また、EB露光とのミックス露光のデモを行う。